

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Новосибирский национальный исследовательский
государственный
университет» (Новосибирский государственный университет,
НГУ)**

Физический факультет

**Квалификационная работа на соискание
степени бакалавра**

Кафедра физики плазмы
(название кафедры)

Горн Александр Андреевич
(фамилия, имя, отчество студента)

Название работы:

Отклик узкого столба плазмы на плотный ультрарелятивистский
пучок заряженных частиц

Научный руководитель:

д-р физ.-мат. наук Лотов Константин Владимирович
(звание, фамилия, имя, отчество, роспись)

Новосибирск — 2016 год

Оглавление

1	Введение	2
2	Линейный отклик	5
2.1	Аналитические выражения для кильватерного потенциала	5
2.2	Эффект роста потенциала при уменьшении плотности плазмы	9
2.3	Отсутствие потенциала снаружи плазменного столба . . .	10
2.4	Проблема осевой инжекции электронного пучка в эксперименте AWAKE	12
3	Нелинейный отклик	15
3.1	Вылет плазменных электронов при низкой плотности плазмы	15
3.2	Искажение кильватерной волны компенсирующий ток .	19
4	Заключение	21
A	Вывод возмущения плотности плазмы	23

1: Введение

Реакция плазмы на пучок хорошо исследована и в общем случае, и в контексте кильватерного ускорения, и с учетом нелинейных эффектов, однако в контексте плазменного кильватерного ускорения появилась задача о реакции узкой плазмы на пучок. Задача появилась из эксперимента AWAKE, который будет проводиться в CERN в конце 2016 года. [3]

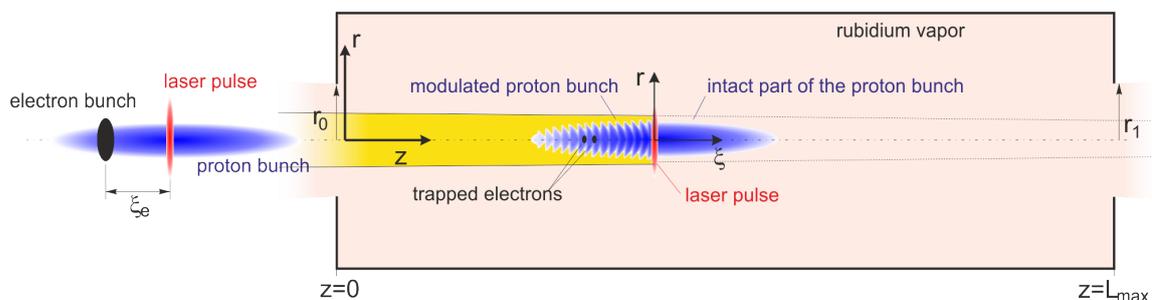


Рис. 1.1: Схема эксперимента AWAKE.

В эксперименте (Рис. 1.1) высокоэнергетический лазерный пучок пройдет сквозь плазменную ячейку, наполненную парами рубидия, и создаст в ней узкий плазменный столб с резкой границей плотности плазмы. Плазма будет свободно вытекать через торцы камеры, что создаст плавный переход плотности к нулю снаружи плазменной ячейки (Рис. 1.2).

Следом за лазерным пучком в плазму влетит протонный и электронный пучки, так называемые драйвер и витнесс. Драйвер будет иметь высокую энергию и возбудит в плазме поля, в которых начнет ускоряться витнесс. Таким образом можно ускорить электронный пучок до энергии порядка 1 TeV. Параметры эксперимента приведены в Таблице 1.1.

Чтобы теоретически предсказать энергию ускоренных частиц, оптимизировать параметры инжекции электронного пучка, а также добиться

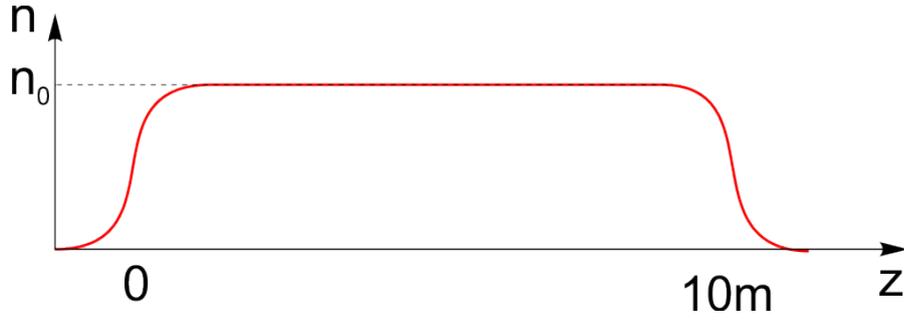


Рис. 1.2: Профиль плотности плазмы в эксперименте AWAKE, за нулевую точку взято положение входного отверстия в плазменную секцию.

Таблица 1.1: Исходные параметры эксперимента AWAKE и обозначения.

Параметр, обозначение	Величина
Плотность плазмы, n_0	$7 \times 10^{14} \text{ см}^{-3}$
Атомная масса ионов плазмы, M_i	85.5
Число частиц в целом пучке, N_b	3×10^{11}
Длина пучка, σ_{zb}	12 см
Радиус пучка, σ_{rb}	0.02 см
Энергоразброс пучка, δW_b	0.35%
Угловой разброс пучка, $\delta\alpha_b = \epsilon_b/\sigma_{rb}$	4.5×10^{-5}
Положение лазерного импульса относительно центра пучка, ξ_s	0 см

наибольшего темпа ускорения, необходимо выяснить какие поля создаются в плазме различными драйверами. При изучении отклика основное внимание уделяется не только полям, но и кильватерному потенциалу, градиент которого имеет смысл силы, действующей на ультрарелятивистскую частицу. Для нахождения полей и кильватерного потенциала, создаваемых в плазме пучком заряженных частиц, в данной работе используется следующая модель (Рис. 1.3): плазма представлена в форме бесконечного столба с радиусом R и однородной плотностью n_0 , по оси которого со скоростью, близкой к скорости света, летит пучок заряженных частиц с произвольной осесимметричной плотностью $n_b = n_b(r, z)$. В соответствии с контекстом эксперимента считается, что радиус пучка r_b всегда меньше радиуса плазмы R . В дальнейшем, в моделировании и других расчетах рассматриваются обрезанные гауссовские пучки.

Так как в эксперименте присутствует область переменной плотности

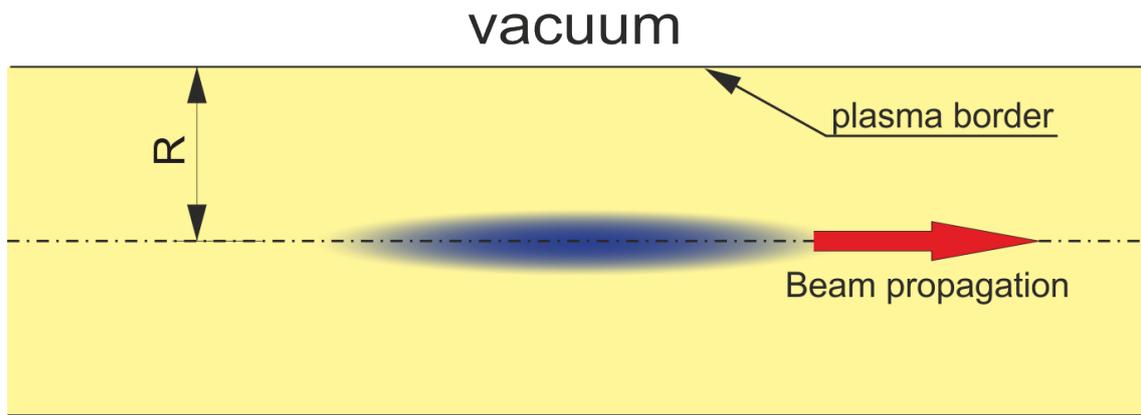


Рис. 1.3: Геометрия задачи.

вблизи входного и выходного отверстий плазменной секции, представляет интерес исследовать отклик при различной плотности плазмы. Существует несколько характерных областей плотности плазмы, заслуживающих внимания, которые определяются параметрами системы: $c \cdot \omega_p < R$, $c \cdot \omega_p > R$ и $n > n_b$, $n < n_b$. В данной работе отклик исследовался двумя способами: с помощью полученных в линейном приближении выражений для полей и кильватерного потенциала и с помощью программы LCODE [4], моделирующей данную задачу в квазистатическом приближении.

2: Линейный отклик

2.1 Аналитические выражения для кильватерного потенциала

В случае линейного отклика плазмы возможно найти аналитическое выражение для кильватерного потенциала используя первый порядок теории возмущений для системы уравнений Максвелла. В данной модели удобно воспользоваться квазистатическим приближением и считать все величины функциями от расстояния от оси системы r и координаты $\xi = z - ct$, сопутствующей пучку.

Запишем покомпонентно полную систему уравнений Максвелла:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \xi}(E_r - B_\phi) &= \frac{4\pi}{c} j_r; & \frac{\partial}{\partial \xi}(E_r - B_\phi) &= \frac{\partial E_z}{\partial r}; & (*) \\ \frac{\partial}{\partial \xi}(B_r + E_\phi) &= 0; & \frac{\partial}{\partial \xi}(B_r + E_\phi) &= -\frac{\partial B_z}{\partial r}; \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r B_\phi &= \frac{4\pi}{c} j_z - \frac{\partial E_z}{\partial \xi}; & \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r E_\phi &= \frac{\partial B_z}{\partial \xi}; \end{aligned}$$

Данную систему уравнений можно значительно упростить, введя кильватерный потенциал, определение которого напрямую следует из уравнения (*).

$$E_r - B_\phi = -\frac{\partial \Phi}{\partial r} \quad (2.1a)$$

$$E_z = -\frac{\partial \Phi}{\partial \xi} \quad (2.1b)$$

В этом случае система примет следующий вид:

$$\begin{aligned}
B_z = 0; \quad B_r = 0; \quad E_\phi = 0; \\
\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \xi \partial r} = -\frac{4\pi}{c} j_r; \\
\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r B_\phi = \frac{4\pi}{c} j_z - \frac{\partial E_z}{\partial \xi};
\end{aligned}
\tag{**}$$

Получим из (***) уравнение для кильватерного потенциала, исключив неизвестную радиальную компоненту тока $j_r = -enV_r$ с помощью линеаризованных уравнения непрерывности

$$-c \frac{\partial \delta n}{\partial \xi} + \frac{n_0}{r} \frac{\partial}{\partial r} r V_r + n_0 \frac{\partial V_z}{\partial \xi} = 0$$

и уравнения движения

$$\frac{\partial V_z}{\partial \xi} = \frac{eE_z}{mc}$$

В итоге уравнение для кильватерного потенциала примет вид:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial \Phi}{\partial r} - \frac{\omega_p^2}{c^2} \Phi = 4\pi e \delta n \tag{2.2}$$

где $\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi n_0 e^2}{m}}$ – плазменная частота.

Правая часть уравнения содержит возмущение плотности плазмы, которое вместе с плазменной частотой зануляется снаружи плазменного столба, тем самым позволяя легко найти решение в этой области.

$$\boxed{\Phi = 0, \quad r > R} \tag{2.3}$$

Чтобы найти решение внутри плазмы, введем штрихованные безразмерные переменные $r' = \frac{\omega_p}{c} r$, $\xi' = \frac{\omega_p}{c} \xi$, $n' = \frac{n}{n_0}$ и перепишем в них уравнение (2.2).

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial r'^2} + \frac{1}{r'} \frac{\partial \Phi}{\partial r'} - \Phi = 4\pi e \delta n \tag{2.4}$$

Конечное уравнение является модифицированным уравнением Бесселя нулевого порядка с правой частью, зависящей от возмущения плотности плазмы. Вывод конечного выражения для возмущения плотности плазмы (2.5) приведен в Приложении.

$$\delta n = -\frac{q}{e} n_b f_{\perp}(r'/k_p) \int_{-\infty}^{\xi} f_{\parallel}(\xi'_0/k_p) \sin(\xi' - \xi'_0) d\xi'_0 \quad (2.5)$$

Сначала решим уравнение (2.4) для одной частицы пучка, находящейся в точке (ξ_0, r_0) , т.е. найдем функцию Грина. Фундаментальными решениями уравнения являются модифицированные функции Бесселя первого ($I_0(r')$) и второго ($K_0(r')$) рода, а значит, при учете граничных условий $[\Phi]_{r'=r'_0} = 0$, $[\Phi]_{r'=R'} = 0$, а также ограниченности потенциала на оси функция Грина примет следующий вид:

$$G(r', r'_0) = 4\pi e \frac{\delta n}{f_{\perp}(r'/k_p) k_p^2} \cdot r'_0 \begin{cases} I_0(r') \left[\frac{K_0(R')}{I_0(R')} I_0(r'_0) - K_0(r'_0) \right] & r' < r'_0 \\ \left[\frac{K_0(R')}{I_0(R')} I_0(r') - K_0(r') \right] I_0(r'_0) & r'_0 \leq r' \leq R' \end{cases} \quad (2.6)$$

Конечное выражение для кильватерного потенциала получается интегрированием функции Грина с поперечной плотностью пучка $f_{\perp}(r'/k_p)$ и состоит из двух множителей: радиальной и продольной функции.

$$\boxed{\Phi(\xi', r') = -\frac{4\pi q c^2 n_b}{\omega_p^2} F(\xi') R(r'), \quad r \leq R} \quad (2.7)$$

Продольная функция имеет простую форму и показывает как кильватерный потенциал осциллирует с плазменной частотой вдоль продольной координаты (Рис. 2.1).

$$F(\xi') = \int_{-\infty}^{\xi'} \sin(\xi' - \xi'_0) f_{\parallel}(\xi'_0) d\xi'_0 \quad (2.8)$$

Радиальная функция имеет более сложную структуру, чем продольная, однако ее график ведет себя просто: он монотонно спадает от некоторого значения на оси системы до нуля на границе плазмы (Рис. 2.2).

$$R(r') = \left[\frac{K_0(R')}{I_0(R')} I_0(r') - K_0(r') \right] \int_0^{r'} r'_0 I_0(r'_0) f_{\perp}(r'_0/k_p) dr'_0 - \quad (2.9)$$

$$- I_0(r') \int_{r'}^{R'} r'_0 \left[\frac{K_0(R')}{I_0(R')} I_0(r'_0) - K_0(r'_0) \right] f_{\perp}(r'_0/k_p) dr'_0$$

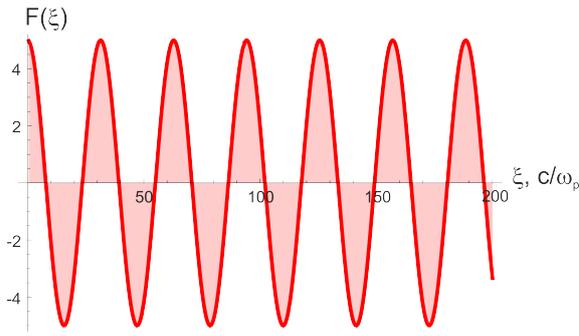


Рис. 2.1: Продольная функция

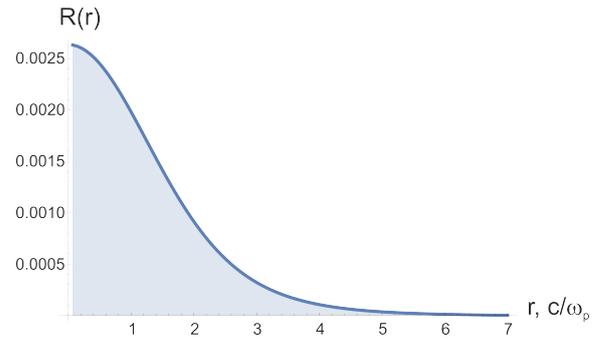


Рис. 2.2: Радиальная функция

2.2 Эффект роста потенциала при уменьшении плотности плазмы

Как уже было сказано в Главе 1, плазма в эксперименте AWAKE имеет плавно спадающий к нулю продольный профиль плотности в районе отверстий плазменной секции, поэтому представляет интерес изучить поведение кильватерного потенциала в широком диапазоне плотностей плазмы (от нуля до базовой плотности $n_0 = 7 \cdot 10^{14} \text{cm}^{-3}$) и найти область применимости аналитического решения, полученного ранее.

Функции $F(\xi')$ и $R(r')$, которые входят в аналитическое выражение для потенциала, содержат в себе штрихованные безразмерные переменные $r' = k_p r$ и $\xi' = k_p \xi$, зависящие от плотности плазмы, а значит, сам кильватерный потенциал тоже зависит от плотности плазмы нетривиальным образом.

На Рис. 2.3 приведено сравнение между такой зависимостью на оси системы в случае ограниченной плазмы (черная гладкая кривая), зависимостью в случае бесконечной плазмы (гладкая оранжевая кривая) и результатами моделирования программой LCODE (красные точки). При построении аналитических функций использовались базовые параметры эксперимента AWAKE (Таблица 1.1).

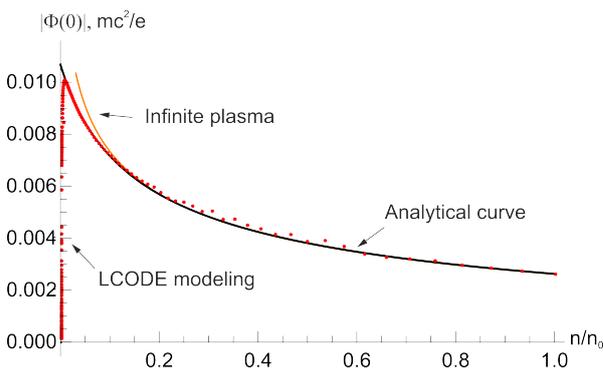


Рис. 2.3: Эволюция потенциала при изменении плотности плазмы

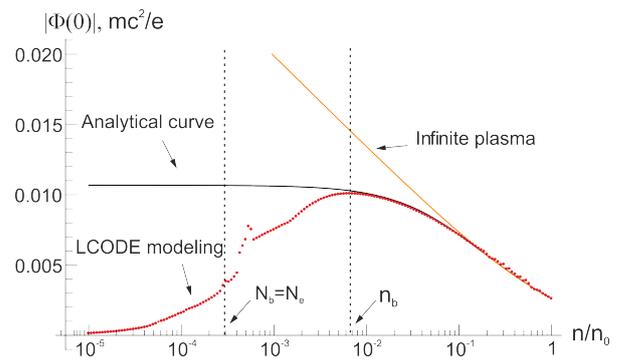


Рис. 2.4: Эволюция потенциала при изменении плотности плазмы в логарифмическом масштабе

На всех кривых виден эффект роста потенциала при понижении

плотности плазмы. Этот эффект наблюдается в первую очередь в бесконечной плазме и лишь модифицируется ограниченной. Радиальная функция в случае бесконечной плазмы возрастает до бесконечности, в то время как кривая для ограниченной плазмы принимает определенное значение при нулевой плотности. Однако, если посмотреть на этот рисунок в логарифмическом масштабе (Рис. 2.4), видно, что график, соответствующий моделированию программой LCODE, начинает убывать при приближении к нулю с момента, когда плотность плазмы становится равной плотности пучка.

Несовпадение между аналитическими кривыми и моделированием начиная с некоторой плотности говорит о том, что с этого момента перестает работать линейное приближение, в рамках которого была получена аналитика. В данном случае линейность нарушается при плотности $n_b = 2 \cdot 10^{12} \text{cm}^{-3}$ и меньше.

2.3 Отсутствие потенциала снаружи плазменного столба

В контексте эксперимента AWAKE предполагается инжекция электронного пучка в кильватерную волну, создаваемую протонным пучком (драйвером) с последующим захватом и ускорением электронов. Ранее было непонятно как повлияет на захват область с переменной плотностью вблизи входного отверстия в плазменную секцию.

Для того, чтобы устранить неопределенность, рассмотрим силы, действующие в такой системе на частицу инжектируемого пучка. Согласно определению кильватерного потенциала (2.1), его градиент имеет смысл силы действующей на частицу с единичным зарядом. При этом важнее всего рассмотреть радиальную компоненту такой силы, так как именно она будет способствовать фокусировке, либо дефокусировке частицы, что непосредственно влияет на захват.

$$F_r = -\frac{\partial\Phi}{\partial r} = E_r - B_\phi \quad (2.10)$$

Сначала исследуем силы, действующие на частицу снаружи плаз-

менного столба. Решение для кильватерного потенциала дает тождественный ноль при $r > R$, что говорит об отсутствии сил в этой области. Получим то же с помощью моделирования программой LCODE. Как видно из формулы (2.10), радиальная сила является разностью радиального электрического и азимутального магнитного полей. Эти величины (Рис. 2.5) и (Рис. 2.6) плавно спадают по радиусу до нуля на бесконечности, однако их разность зануляется во всей области снаружи плазмы (Рис. 2.7), что совпадает с теорией.

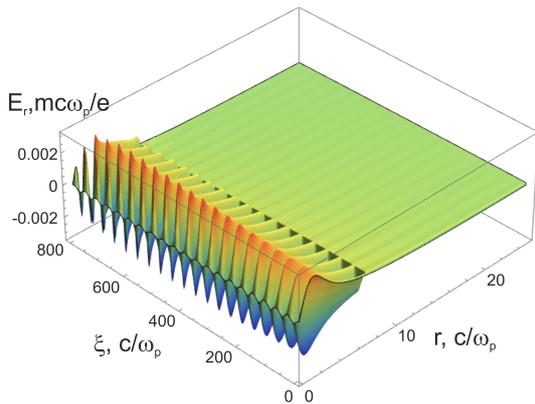


Рис. 2.5: Электрическое поле

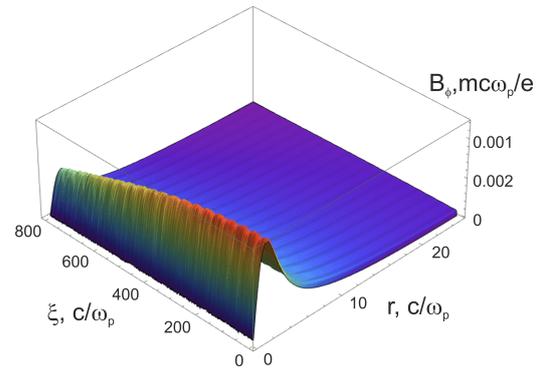


Рис. 2.6: Магнитное поле

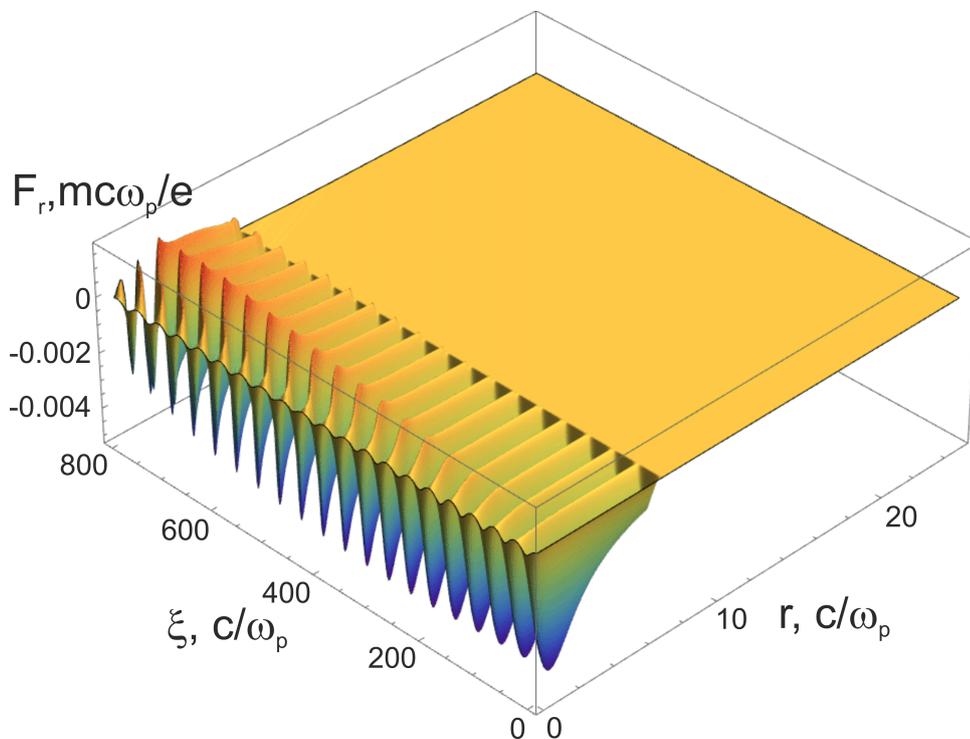


Рис. 2.7: Радиальная сила

2.4 Проблема осевой инжекции электронного пучка в эксперименте AWAKE

Исследуем теперь фокусирующую силу внутри плазмы. Радиальная сила при $r < R$ осциллирует с плазменной длиной волны. Предположим, что в плазму инжектируется пучок отрицательно заряженных частиц, например, электронов как в эксперименте AWAKE, тогда в зависимости от продольной координаты инжекции из-за осцилляций создаются два вида областей: фокусирующие (оттенки красного на Рис. 2.7) и дефокусирующие (оттенки синего на Рис. 2.7). Электроны, попавшие в область дефокусировки, получают положительный радиальный импульс и не захватываются в кильватерную волну, вылетев за пределы плазмы. Таким образом, для того, чтобы обеспечить наилучший захват электронов в кильватерную волну, необходимо инжектировать их в области фокусировки.

Однако, из Рис. 2.7 видно, что радиальная сила помимо осциллирующей имеет также постоянную компоненту, в какой-то степени повторяющую форму драйвера (в данном случае протонного пучка). Постоянная компонента вносит отрицательную добавку в радиальную силу, что в среднем приводит к доминированию дефокусирующей силы по всей длине пучка.

Ранее в эксперименте AWAKE предполагалась инжекция электронного пучка вдоль оси системы следом за протонным пучком.

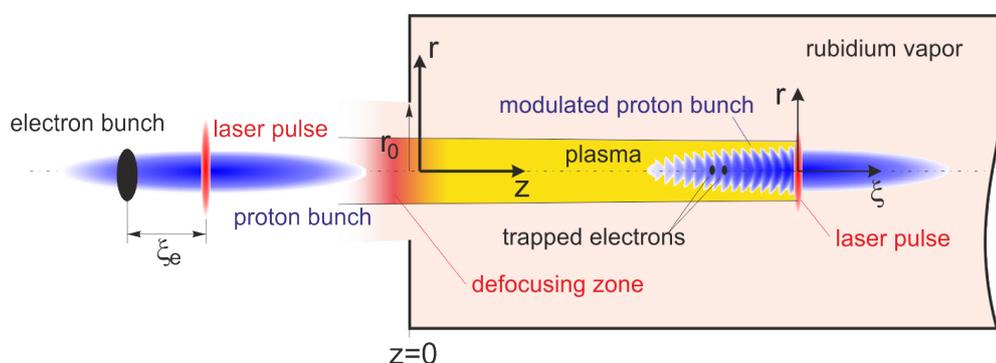


Рис. 2.8: Дефокусирующая область вблизи входного отверстия в плазменную секцию эксперимента AWAKE

При такой инжекции пучок неизбежно попадет в зону переменной

плотности вблизи входного отверстия в плазменную секцию. В этой области частота колебаний кильватерной волны $\omega_p \sim \sqrt{n}$ меняется в зависимости от плотности плазмы, смещая тем самым плоскость постоянной фазы в сопутствующем пучку окне (Рис. 2.9). В этом случае инжектируемые электроны будут попеременно попадать то в фокусирующую, то в дефокусирующую фазу и в среднем дефокусироваться, что воспрепятствует захвату частиц в волну для последующего ускорения.

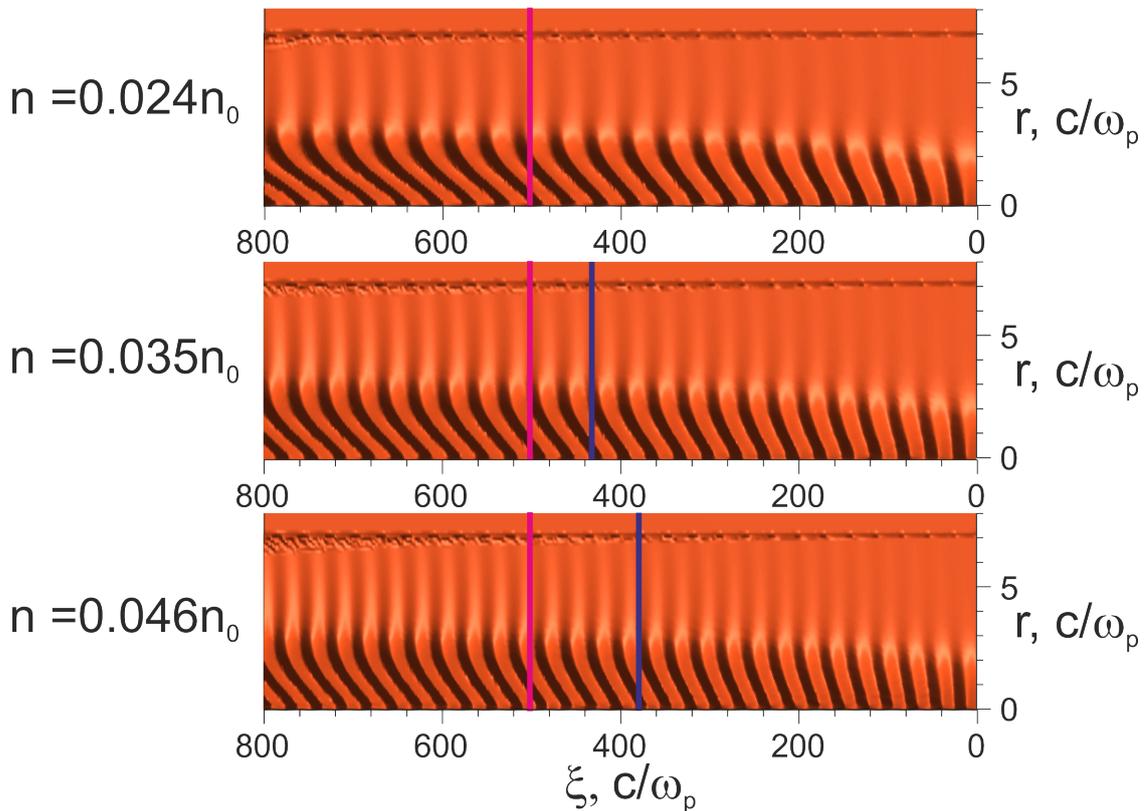


Рис. 2.9: Смещение фазы кильватерной волны (синяя линия) относительно положения электронного пучка (фиолетовая линия) на диаграмме электронной плотности плазмы при инжекции электронов в область переменной плотности.

Таким образом, чтобы добиться эффективной инжекции частиц в волну, необходимо как-то обойти дефокусирующую область. Было предложено инжектировать электронный пучок не вдоль оси системы, а под некоторым углом к ней вглубь плазмы. Тогда электронный пучок обойдет опасную зону переменной плотности снаружи плазменного столба, где на него не будет действовать никаких сил.

Для такой постановки задачи с помощью программы LCODE был выбран оптимальный угол инжекции $\alpha = 0.009$ радиан, а затем прове-

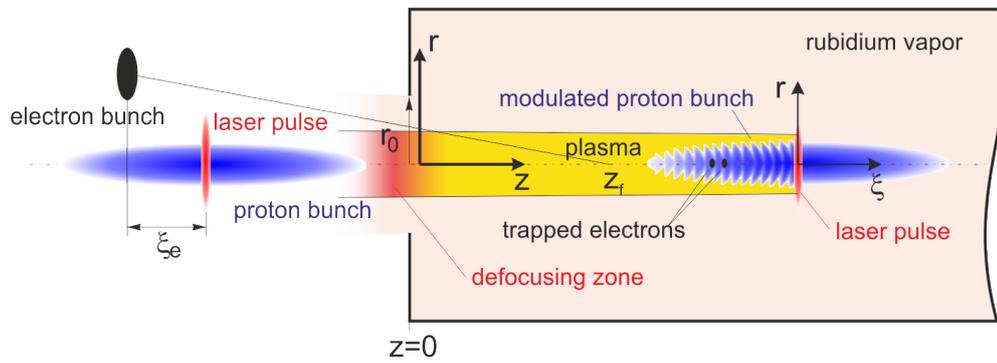


Рис. 2.10: Схема "косой"инжекции электронного пучка в эксперименте AWAKE.

дено финальное моделирование и получен энергетический спектр ускоренных электронов на выходе из плазменной секции. [2] На Рис. 2.11 приведено сравнение таких энергетических спектров для случая "косой"инжекции и инжекции вдоль оси. Видно, что во втором случае ни один электрон не захватился в волну, в то время как при косой инжекции около 40% электронов были захвачены и ускорены в среднем до энергии 1.5 GeV, что подтверждает приведенные выше рассуждения.

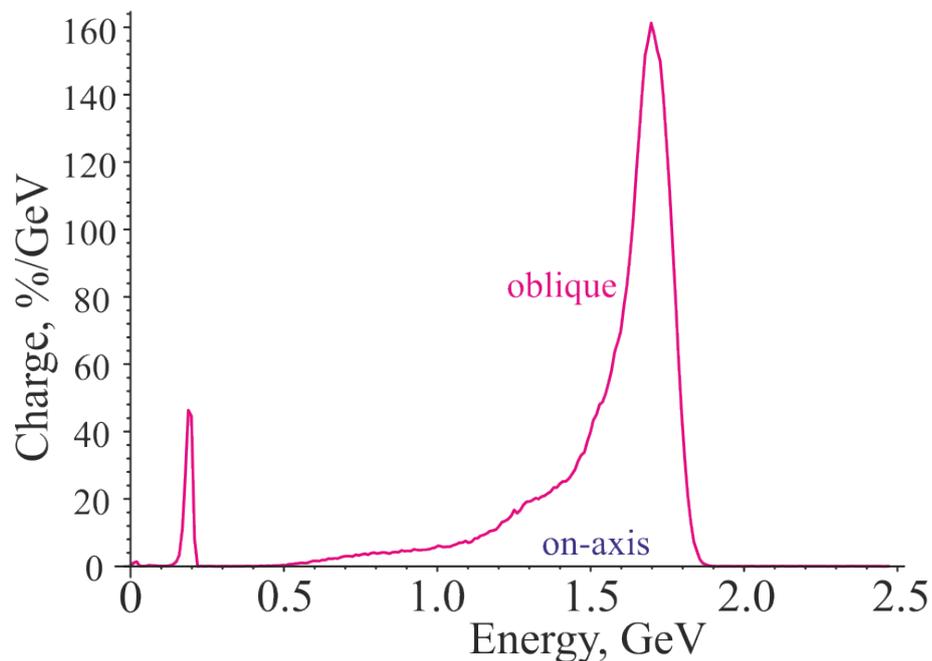


Рис. 2.11: Энергетический спектр ускоренных электронов на выходе из плазменной секции для случая осевой (синяя кривая) и "косой" (красная кривая) инжекции.

3: Нелинейный отклик

Как уже было сказано в разделе 2.2, линейное приближение, в котором получена аналитика для кильватерного потенциала, работает лишь при плотности плазмы выше плотности пучка. Однако, протонный пучок, влетая в плазменную секцию в эксперименте AWAKE, пройдет через плазму с широким интервалом плотности: от нуля до базовой n_0 . Поэтому необходимо исследовать отклик также и при низкой плотности плазмы используя единственный доступный в этом случае метод - моделирование.

3.1 Вылет плазменных электронов при низкой плотности плазмы

Моделирование программой LCODE показывает, что в обсуждаемой в работе задаче (Рис. 1.3) в некотором диапазоне плотностей плазмы ниже плотности пучка n_b наблюдается вылет плазменных электронов за границу плазменного столба (Рис. 3.1).

Это явление опасно в первую очередь тем, что вылетающие электроны выносят с собой из плазмы кильватерный потенциал, оказывающий непредсказуемое влияние на электронный пучок в схеме "косой" инжекции.

Чтобы понять причину вылета электронов из плазмы при низкой плотности, найдем и изучим траектории этих частиц. Для этого с помощью теоремы Гаусса приближенно найдем электрическое поле в обсуждаемой системе (Рис. 1.3) и подставим в уравнение движения. При этом будем считать, что плазма холодная, и плотность ионов однородна внутри плазменного столба $n_i(t, z, r) = const = n_i$, а пучок имеет гаус-

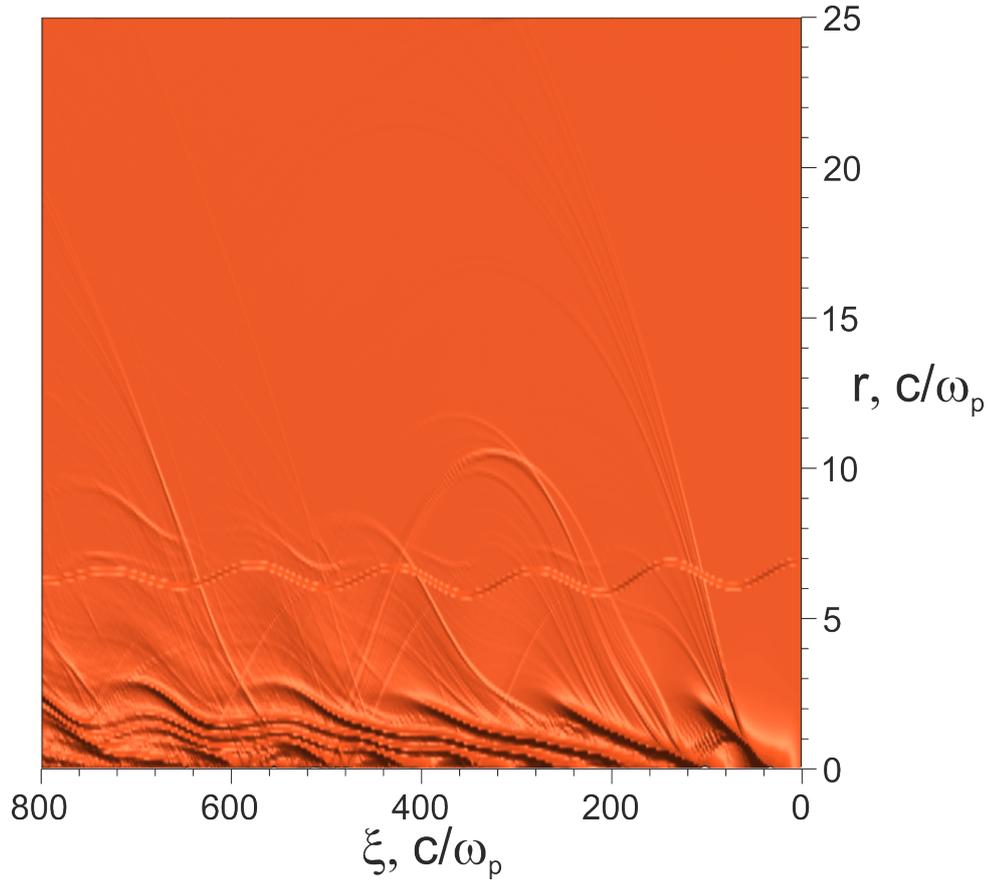


Рис. 3.1: Плазменные электроны, струями вылетающие за границу плазменного столба на пространственной диаграмме плотности плазмы.

совский профиль по обеим координатам: $n_b(\xi, r) = n_b e^{-\frac{\xi^2}{2\sigma_\xi^2} - \frac{r^2}{2\sigma_r^2}}$, причем его продольная плотность мало меняется на исследуемом промежутке по ξ длиной L .

$$E_r(t, r) \cdot 2\pi r L = -4\pi e \int_0^r (n_e(t, r) - n_i(t, r) - n_b(t, r)) 2\pi r L dr$$

Упростим интеграл, включающий в себя неизвестную плотность электронов, воспользовавшись условием сохранения числа частиц в элементарном объеме между двумя траекториями электронов с начальными радиусами r_0 и $r_0 + dr_0$:

$$n_e(t, r) r dr = n_{e0} r_0 dr_0$$

где n_{e0} - это начальная однородная по объему плазмы плотность элект-

тронов.

Тогда окончательное выражение для радиального электрического поля примет вид:

$$E_r = -\frac{4\pi e}{r} \left[\int_0^{r_0} n_{e0} r dr - \int_0^r (n_i(t, r) + n_b(t, r)) r dr \right] \quad (3.1)$$

Чтобы получить уравнение траектории плазменного электрона, подставим это выражение в уравнение движения $m \frac{dV}{dt} = -eE$ и сделаем замену $\xi = z - ct$.

$$\frac{d^2 r}{d\xi^2} = \frac{4\pi e^2}{mc^2 r} \left[\int_0^{r_0} n_{e0} r dr - \int_0^r (n_i(\xi, r) + n_b(\xi, r)) r dr \right] \quad (3.2)$$

В данной работе это уравнение было численно решено с помощью программного пакета Wolfram Mathematica. [5] Вычисленные траектории электронов с различными начальными радиусами приведены на Рис. 3.2.

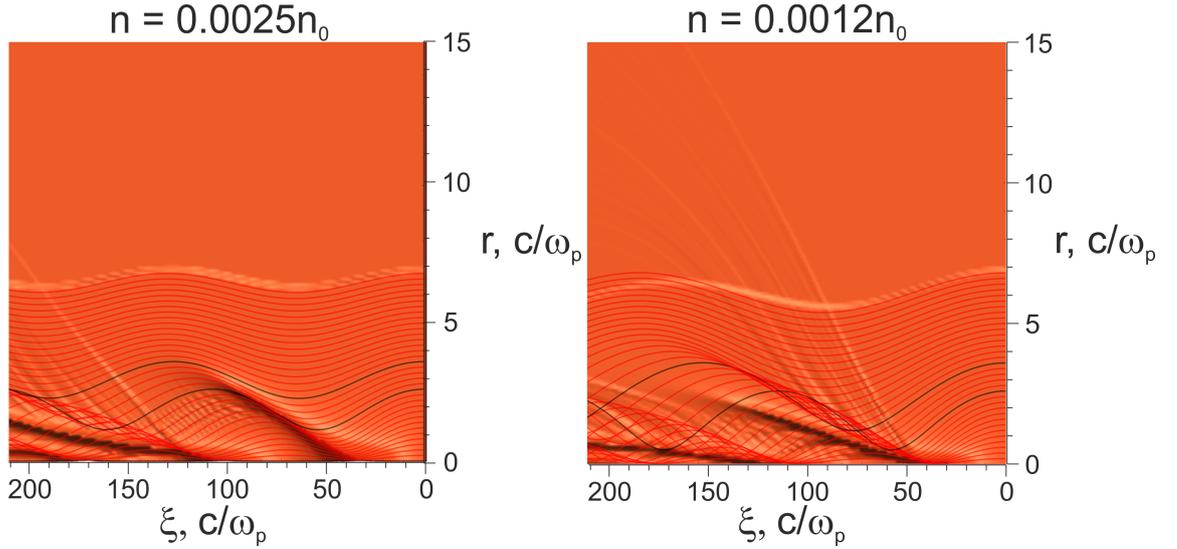


Рис. 3.2: Аналитические траектории плазменных электронов, соответствующие различной плотности плазмы, на фоне электронной плотности, полученной с помощью моделирования программой LCODE.

Приближение, в котором получены аналитические решения для траекторий не учитывает влияние их пересечений, т.е. момента опрокидывания плазменной волны, однако из сравнения аналитики с моделированием видно, что начиная с некоторой плотности плазмы электроны начинают вылетать как раз из тех областей, где произошло опрокиды-

вание. Это можно объяснить следующим образом: в осесимметричном случае на плазменный электрон с радиусом $r = r_e$ действуют кулоновские силы со стороны только лишь тех частиц, для которых $r < r_e$. При пересечении траекторий двух электронов (черные траектории на Рис. 3.2) один из них, имевший больший радиус, попадет во внутреннюю область другого, тем самым увеличив отрицательный заряд в этой области и, соответственно, силу, выталкивающую второй электрон. Если пересечений произойдет достаточно много, что наблюдается при низкой плотности плазмы, то отталкивающая сила превзойдет притягивающую со стороны протонного пучка, и электрон беспрепятственно вылетит за пределы плазменного столба.

3.2 Искажение кильватерной волны компенсирующим током

Известно, что плазма обладает высокой проводимостью, а значит, при прохождении через нее пучка заряженных частиц, имеющего ненулевой ток, в этой среде, в силу сохранения магнитного потока, возникнет обратный ток, равный по величине току пучка - так называемый компенсирующий ток. Частицы плазмы, генерирующие кильватерную волну в такой системе, приобретут постоянную компоненту скорости, и как любой движущийся источник, изменят частоту излучаемой волны на $\delta\omega(r) \sim j_z(r) = -en(r)V_z$. Профиль плотности пучка в обсуждаемой задаче имеет форму, зависящую от радиуса, следовательно, волна будет по-разному искажаться в зависимости от поперечной координаты. Для случая гауссовской формы пучка, частота колебаний на оси системы будет ниже, чем на границе плазмы, что можно наблюдать на диаграмме радиальной силы, полученной в результате моделирования (Рис. 3.3).

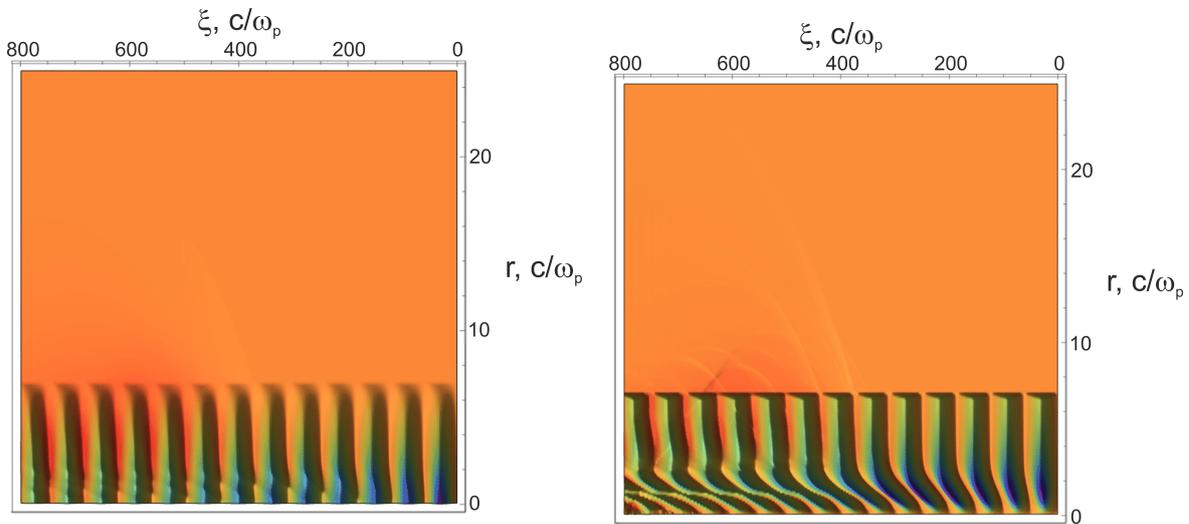


Рис. 3.3: Искажение структуры кильватерного потенциала (левый рисунок) и радиальной компоненты силы (правый рисунок) компенсирующим током.

Можно было бы ожидать то же самое и от диаграммы кильватерного потенциала, производная по радиусу которого является радиальной силой, однако поперечного искажения волны на этом графике не наблю-

дается (Рис. 3.3). Потенциал ведет себя так, как это предсказывают аналитические выражения, полученные в разделе 2.1 в линейном приближении: он осциллирует строго с плазменной частотой вдоль продольной координаты ξ при любом радиусе.

4: Заключение

В данной работе получены и проанализированы аналитические выражения для кильватерного потенциала в осесимметричной задаче об отклике ограниченного столба плазмы на ультрарелятивистский пучок заряженных частиц. С использованием моделирования программой LCODE определена область применимости последних. Полученная аналитика согласуется с зарубежными статьями на схожую тему. [1]

С помощью аналитических выражений и моделирования программой LCODE в работе исследовано влияние областей неоднородной плотности в эксперименте AWAKE, запуск которого запланирован на конец 2016 года.

А именно:

- Обнаружен эффект возрастания кильватерного потенциала на оси при понижении плотности плазмы.
- Показано отсутствие сил, действующих на заряженную частицу снаружи плазменного столба.
- Показана необходимость использования схемы "косой" инжекции в эксперименте AWAKE.
- Выявлено и объяснено явление вылета электронов из плазмы низкой плотности в контексте обсуждаемой задачи.
- Продемонстрировано как компенсирующий ток по-разному искажает структуру кильватерного потенциала и полей.

Литература

- [1] Y. Fang, et al., The effect of plasma radius and profile on the development of self-modulation instability of electron bunches, *Physics of Plasmas* (2014), <http://dx.doi.org/10.1063/1.4872328>
- [2] A. Caldwell, et al., Path to AWAKE: Evolution of the concept, *Nuclear Instruments Methods in Physics Research A* (2016), <http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2015.12.050>
- [3] E. Gschwendtner, et al., AWAKE, The Advanced Proton Driven Plasma Wakefield Acceleration Experiment at CERN, *Nuclear Instruments Methods in Physics Research A* (2016), <http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2016.02.026>
- [4] LCODE <http://www.inp.nsk.su/~lotov/autobuilds-lcode/lcode-stable/manual-r652/manual.pdf>.
- [5] Wolfram Mathematica <https://www.wolfram.com/mathematica/>.

А: Вывод возмущения плотности плазмы

Выражение для возмущения несложно получить из уравнения непрерывности

$$\frac{\partial \delta n}{\partial t} + n_0 \operatorname{div} \vec{V} = 0,$$

продифференцировав его по времени, выразив производную скорости по времени из линеаризованного уравнения движения

$$\frac{d\vec{V}}{dt} = -\frac{e}{m} \vec{E}$$

и подставив дивергенцию электрического поля из одного из уравнений Максвелла

$$\operatorname{div} \vec{E} = 4\pi(\rho_b - \delta n).$$

$$\frac{\partial^2 \delta n}{\partial t^2} = -n_0 \operatorname{div} \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = \frac{n_0 e}{m} \operatorname{div} \vec{E} = \omega_p^2 \left(\frac{\rho_b}{e} - \delta n \right)$$

Сделаем замену $\xi = z - ct$ и выразим итоговое уравнение на δn .

$$\frac{\partial^2 \delta n}{\partial \xi^2} + \frac{\omega_p^2}{c^2} \delta n = \frac{q \omega_p^2}{e c^2} n_b f_{\parallel}(\xi) f_{\perp}(r) \quad (\text{A.1})$$

Решить это уравнение можно так же, как уравнение (2.2) с помощью функции Грина. Фундаментальными решениями уравнения (A.1) являются $\sin(k_p \xi)$ и $\cos(k_p \xi)$. Учитывая, что возмущение плазмы не может распространяться со скоростью большей скорости света, т.е. $\delta n = 0$ при $\xi > \xi_0$, а также условие непрерывности по ξ , получим следующую функцию Грина:

$$G(\xi, \xi_0) = \begin{cases} -\frac{q}{e} n_b f_{\perp}(r) \sin(k_p(\xi - \xi_0)) & \xi < \xi_0 \\ 0 & \xi \geq \xi_0 \end{cases} \quad (\text{A.2})$$

В результате, возмущение плотности плазмы может быть найдено интегрированием функции Грина с продольной плотностью пучка.

$$\delta n = -\frac{q}{e} k_p n_b f_{\perp}(r) \int_{-\infty}^{\xi} f_{\parallel}(\xi_0) \sin(k_p(\xi - \xi_0)) d\xi_0 \quad (\text{A.3})$$